

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分
 【発行日】平成 23 年 1 月 6 日 (2011.1.6)

【公表番号】特表 2010-510093 (P2010-510093A)
 【公表日】平成 22 年 4 月 2 日 (2010.4.2)
 【年通号数】公開・登録公報 2010-013
 【出願番号】特願 2009-537269 (P2009-537269)
 【国際特許分類】

B 4 1 C 1/02 (2006.01)

B 4 1 N 1/12 (2006.01)

【F I】

B 4 1 C 1/02

B 4 1 N 1/12

【手続補正書】
 【提出日】平成 22 年 10 月 13 日 (2010.10.13)

【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

フレキシソ印刷プレートの形成法であって、
 マスターツールパターンを画定する複数のくぼみを有し、前記くぼみ内に溶剤が配置され
 たマスターツールの上へ高分子基材を配置することと、

前記溶剤を前記高分子基材中へ拡散させて、前記マスターパターンに対して補完的な基
 材レリーフパターンを形成することと、

前記基材レリーフパターンを硬化させて、フレキシソ印刷プレートを形成することと、を
 含む、フレキシソ印刷プレートの形成法。

【請求項 2】

主表面及び前記主表面から離れるように突出するレリーフパターンを有する高分子基材
 を含む、フレキシソ印刷プレートであって、前記レリーフパターンが、少なくとも 20 マイ
 クロメートルの高さを有し、かつ、前記レリーフパターンが、15 マイクロメートル以下
 の横方向の寸法を有する形状部を含む、フレキシソ印刷プレート。

【請求項 3】

フレキシソ印刷プレートの形成法であって、
 微細構造を有する剛性マスターツールを提供することと、
 前記剛性マスターツールを用いて高分子基材上で前記微細構造を複製して、微細構造を
 複製した高分子ウェブマスターツールを形成することと、
 前記微細構造を複製した高分子ウェブマスターツールを用いて第 2 高分子基材上で前記
 微細構造を複製して、微細構造を複製したフレキシソ印刷プレートを形成することと、を含
 み、
 前記微細構造が、10 マイクロメートル以下の横方向の寸法を有する形状部を含み、
 ダイヤモンド旋削によって、前記剛性マスターツール微細構造を形成することを更に含
 む、フレキシソ印刷プレートの形成法。